



(11) EP 1 296 191 B8

(12)

**KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

- (15) Korrekturinformation:  
**Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)**  
**Bibliographie INID code(s) 73**
- (48) Corrigendum ausgegeben am:  
**23.01.2008 Patentblatt 2008/04**
- (45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:  
**07.11.2007 Patentblatt 2007/45**
- (21) Anmeldenummer: **02019258.9**
- (22) Anmeldetag: **28.08.2002**

**(54) Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften mehrerer optischer Elemente**

Method of optimising the imaging properties of a plurality of optical elements

Méthode d'optimisation des caractéristiques de formation d'image de plusieurs éléments optiques

<p>(84) Benannte Vertragsstaaten:  <b>DE NL</b></p> <p>(30) Priorität: <b>21.09.2001 DE 10146499</b></p> <p>(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  <b>26.03.2003 Patentblatt 2003/13</b></p> <p>(60) Teilanmeldung:  <b>07021395.4</b></p> <p>(73) Patentinhaber: <b>Carl Zeiss SMT AG</b>  <b>73447 Oberkochen (DE)</b></p> <p>(72) Erfinder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Geh, Bernd</b>  <b>73432 Aalen (DE)</b></li> <li>• <b>Gräupner, Paul</b>  <b>73430 Aalen (DE)</b></li> <li>• <b>Stammler, Thomas, Dr.</b>  <b>73430 Aalen (DE)</b></li> <li>• <b>Stenkamp, Dirk, Dr.</b>  <b>73457 Essingen (DE)</b></li> <li>• <b>Stühler, Jochen</b>  <b>73431 Aalen (DE)</b></li> <li>• <b>Wurmbrand, Klaus</b>  <b>79460 Hüttlingen (DE)</b></li> </ul>	<p>(74) Vertreter: <b>Ostertag, Ulrich et al</b>  <b>Patentanwälte</b>  <b>Ostertag &amp; Partner</b>  <b>Epplestr. 14</b>  <b>70597 Stuttgart (DE)</b></p> <p>(56) Entgegenhaltungen:  <b>EP-A- 0 992 853</b> <b>EP-A- 1 128 218</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 07, 29. September 2000 (2000-09-29) -&amp; JP 2000 121491 A (NIKON CORP), 28. April 2000 (2000-04-28)</b></li> <li>• <b>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1998, Nr. 11, 30. September 1998 (1998-09-30) -&amp; JP 10 154657 A (NIKON CORP), 9. Juni 1998 (1998-06-09)</b></li> <li>• <b>FUKUDA HIROSHI ET AL: "Determination of high-order lens aberration using phase/amplitude linear algebra" JOURNAL OF VACUUM SCIENCE &amp; TECHNOLOGY B: MICROELECTRONICS PROCESSING AND PHENOMENA, AMERICAN VACUUM SOCIETY, NEW YORK, NY, US, Bd. 17, Nr. 6, November 1999(1999-11), Seiten 3318-3321, XP012007927 ISSN: 0734-211X</b></li> </ul>
---	--

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).